IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Shinji Isokawa

Serial No.: Unassigned

Filed: Herewith

For: CHIP-TYPE SEMICONDUCTOR

Assistant Commissioner for Patents

LIGHT-EMITTING DEVICE

Examiner: Unassigned

Group Art Unit: Unassigned

Docket: 362-51

Dated: December 7, 2000

Washington, DC 20231

CLAIM FOR PRIORITY AND TRANSMITTAL **OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT**

Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. § 119 based on Japanese Patent Application No. 11-348648 filed December 8, 1999. A certified copy of the priority document is submitted herewith.

The Commissioner is hereby authorized to charge any fees associated with this communication to Deposit Account No. 08-2461. A duplicate copy of this sheet is attached.

Respectfully submitted,

Gerald T. Bodner

Registration No.: 30,449 Attorney for Applicant

HOFFMANN & BARON, LLP 6900 Jericho Turnpike Syosset, New York 11791 (516) 822-3550 GTB:slt

EXPRESS MAIL CERTIFICATE

Date 12/7/00 tabel No. EL 49245230. I hereby certify that on the date indicated above, I deposited this paper or fee with the U.S. Postal Servithat it was addressed for delivery to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 2023 by EXPRESS MAIL Post Office to Addressee Servit

日 PATENT OFFICE

JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

8日 1999年12月

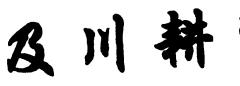
願 Application Number: 平成11年特許願第348648号

人 顧 Applicant (s):

ローム株式会社

2000年10月20日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





特平11-348648

【書類名】 特許願

【整理番号】 99L08P2135

【提出日】 平成11年12月 8日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 33/00

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市右京区西院溝崎町21 ローム株式会社内

【氏名】 磯川 慎二

【特許出願人】

【識別番号】 000116024

【氏名又は名称】 ローム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100090181

【弁理士】

【氏名又は名称】 山田 義人

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014812

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

チップ型半導体発光装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板、

前記基板に形成される一対の電極、

前記一対の電極に電気的に接続される半導体発光チップ、

前記半導体発光チップおよび前記一対の電極のそれぞれの一部を封止するモールド、および

前記モールド内の前記電極に形成され、かつ、外側から内側へ向かって高くなる段差を備える、チップ型半導体発光装置。

【請求項2】

前記電極はCu層を含み、前記段差は前記Cu層の肉厚を変化させることにより形成される、請求項1記載のチップ型半導体発光装置。

【請求項3】

前記電極の最上層はAu層である、請求項1または2記載のチップ型半導体発 光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明はチップ型半導体発光装置に関し、特にたとえば基板上の電極に接続 された半導体発光チップを電極の一部とともにモールドした、チップ型半導体発 光装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

この種の従来のチップ型半導体発光装置を図4に示す。このチップ型半導体発 光装置1は、基板2を含み、基板2の両端部には、一対の電極3および4が形成 される。電極3および4は、それぞれ端子部3aおよび4aを含み、各端子部3 aおよび4aの幅方向中央部には、突出部3bおよび4bが形成される。また、 一方の突出部4bの先端にはパッド4cが形成される。電極3および4のそれぞれは、図4(B)に示すように、Cu(銅)層,Ni(ニッケル)層およびAu(金)層の3層で構成される。このように、最上層にAu層が形成されることにより、半田の被着性および金属線5との電気的接続性の向上が図られる。

[0003]

そして、電極4のパッド4cには、半導体発光チップ(以下、「LEDチップ」と略称する)6がボンディングされて、その裏面電極が電極4と電気的に接続され、LEDチップ6の表面電極6aと電極3の突出部3bとが金属線5でワイヤボンディングされる。さらに、突出部3b,突出部4b,パッド4c,金属線5およびLEDチップ6等が、透光性の合成樹脂からなるモールド7で封止される。

[0004]

このようなチップ型半導体発光装置1は、基板2の裏面を回路基板の表面に接触させた状態で実装され、リフロー工程において、端子部3aおよび4aと回路基板の配線パターンとが半田8により電気的に接続される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

従来技術において、リフロー処理を繰り返して実施すると、図4 (A) に示すように、溶融された半田8が突出部3 b および4 b を伝わってモールド7内に侵入し、金属線5やLEDチップ6に到達するおそれがあった。そして、半田8が金属線5やLEDチップ6に到達すると、到達時の衝撃によってこれらが剥離または損傷され、チップ型半導体発光装置1が正常に動作しなくなるおそれがあった。

[0006]

それゆえに、この発明の主たる目的は、半田によってモールド内の部品が剥離 等されるのを防止できる、チップ型半導体発光装置を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】

この発明は、基板、基板に形成される一対の電極、一対の電極に電気的に接続

される半導体発光チップ、半導体発光チップおよび一対の電極のそれぞれの一部 を封止するモールド、およびモールド内の電極に形成され、かつ、外側から内側 へ向かって高くなる段差を備える、チップ型半導体発光装置である。

[8000]

リフロー処理時に溶融された半田が電極の表面を伝わってモールド内に侵入す ると、この半田は、外側から内側へ向かって高くなる段差の壁に突き当たる。つ まり、モールド内に侵入した半田の進行が、金属線やLEDチップ等の手前で阻 止される。

[0009]

【発明の効果】

この発明によれば、段差によって半田の進行を阻止できるので、モールド内の 部品が半田により剥離等されるのを防止できる。

[0010]

この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行 う以下の実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。

[0011]

【実施例】

図1に示すこの実施例のチップ型半導体発光装置10は、携帯電話機やPHS 等のような携帯用電子機器の照明等に適したものであり、絶縁性の基板12を含 む。基板12は、ガラスクロスなどに耐熱性のBT樹脂を含浸させたBTレジン 等からなり、そのサイズ(縦×横×高さ)は、近年の小型化の要請に応じて、た とえば2. 0 mm×1. 25 mm×0. 8 mm、または、1. 6 mm×0. 8 m $m \times 0$. 8mm程度と小さく設定される。なお、発光装置10は、 $10cm \times 5$ c m程度の大きさの基板12に多数の素子をマトリクス状に形成し、これを切断 することにより得られる。

[0012]

基板12の両端部には、一対の電極14および16が形成される。電極14お よび16は、基板12の下面から上面にわたって形成される端子部14aおよび

16 aを含み、端子部14 aおよび16 aのそれぞれの幅方向中央部から延びて 突出部14 bおよび16 bが形成される。突出部14 bおよび16 bの長手方向 中央部には、外側(端子部側)から内側(基板中央側)へ向かって高くなる段差 18が、それらの幅方向全長にわたって形成される。そして、一方の突出部16 bの先端にはパッド16cが形成される。なお、このような電極14および16 は、図1(c)に示すように、Cu層、Ni層およびAu層の3層からなり、段 差18は、Cu層の肉厚を外側(端子部側)から内側(基板中央側)へ向かって 厚くすることによって形成される。最上層をAu層としたのは、半田40の被着 性および金属線22との電気的接続性を良好にするためである。

[0013]

そして、パッド16cには、LEDチップ20がボンディングされて、その裏 面電極と電極16とが電気的に接続される。また、LEDチップ20の表面電極 20aと電極14の突出部14bとが金線等のような金属線22でワイヤボンデ ィングされる。

[0014]

さらに、基板12の上面には、透光性の合成樹脂からなるモールド24が装着 され、これによって、突出部14b,突出部16b,パッド16c,LEDチッ プ20および金属線22等が密封される。

[0015]

以下には、図2に従って、電極14および16に段差18を形成する方法を説 明する。

[0016]

まず、図2(A)に示すように、表面に所定の厚み($16\sim20\mu$ m程度)の Cu箔が形成された基板12を準備し、Cu箔をパターンエッチングして、所定 のパターン26を形成する。

[0017]

次に、図2(B)に示すように、パターン26の表面に第1Cu層28を所定 の厚み (10μm程度) で電界メッキにより形成する。

[0018]

続いて、図2(C)に示すように、段差18よりも手前の部分にレジスト30を塗布し、第1Cu層28の上に第2Cu層32を所定の厚み(10μm程度)で電界メッキにより形成する。

[0019]

そして、図2 (D) に示すように、レジスト30を除去した後、第1Cu 層2 8 および第2Cu 層32の上にNi 層34 およびAu 層36を電界メッキにより順次形成する。ここで、Ni 層34の厚みは、 $5\sim10\mu$ m程度に設定され、Au u 層36の厚みは、 $0.3\sim0.5\mu$ m程度に設定される。

[0020]

このように、段差18は、Cu層の肉厚を外側から内側へ向かって厚くすることによって形成される。

[0021]

発光装置10は、図3に示すように、基板12を回路基板38の表面に直接載置した状態で実装され、リフロー工程において、端子部14aおよび16aと回路基板38の配線パターンとが半田40により電気的に接続される。リフロー処理時に、溶融された半田40が電極14および16の表面を伝わってモールド24内に侵入すると、半田40が段差18の壁に突き当たって、それ以上の進行が阻止される。

[0022]

この発明によれば、段差18によって半田40の進行を阻止できるので、モールド24内の部品(LEDチップ20および金属線22等)が半田40によって 剥離等されるのを防止できる。したがって、発光装置10の誤動作を防止できる

[0023]

なお、上述の実施例では、Cu層、Ni層およびAu層を電界メッキにより形成しているが、これらの層を無電界メッキ(化学メッキ)により形成してもよい。また、この場合には、Ni層とAu層との間にPd(パラジウム)層等のバリア層を形成してもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の一実施例を示す図解図である。

【図2】

図1実施例における段差の形成方法を示す図解図である。

【図3】

図1実施例において半田の侵入を阻止した状態を示す図解図である。

【図4】

従来技術を示す図解図である。

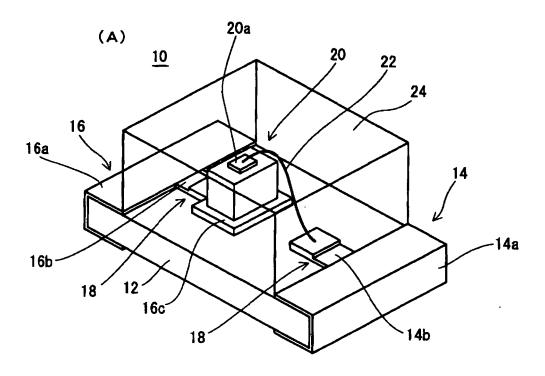
【符号の説明】

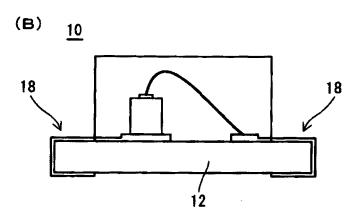
- 10 …チップ型半導体発光装置
- 12 …基板
- 14,16 …電極
- 18 …段差
- 20 …半導体発光チップ
- 22 …金属線
- 24 …モールド

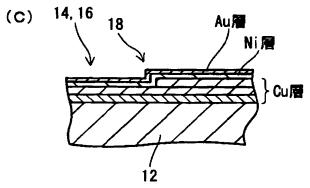
【書類名】

図面

【図1】

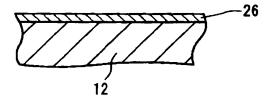


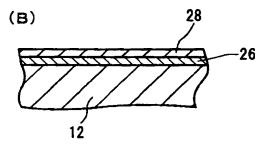


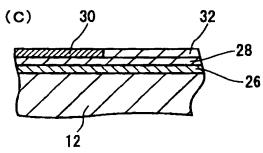


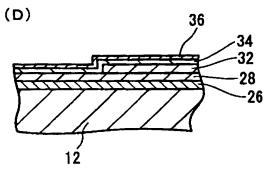
【図2】



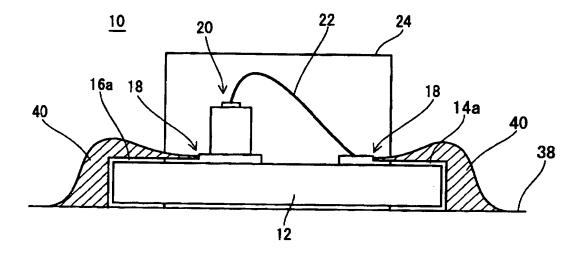




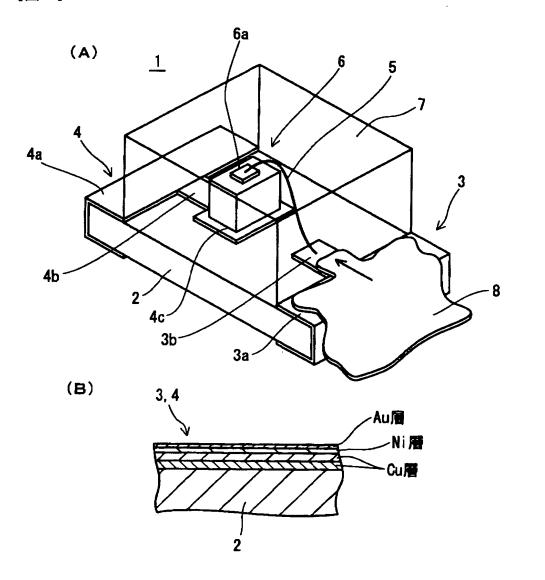




【図3】



【図4】



【書類名】

要約書

【要約】

チップ形半導体発光装置10は、基板12上に形成された1対の 電極14および16に接続された半導体発光チップ20を含み、半導体発光チッ プ20は各電極14および16のそれぞれの一部とともに樹脂によってモールド される。電極14および16は、Cu層, Ni層およびAu層が下層から順に積 層された積層構造を有し、С u 層の肉厚を変化させることによってモールド24 内に段差18が形成される。

【効果】 段差18によって半田の進行を阻止できるので、モールド24内 の部品が半田により剥離等されるのを防止できる。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000116024]

1. 変更年月日 1990年 8月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

氏 名 ローム株式会社